(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-235758 (P2001-235758A)

(43)公開日 平成13年8月31日(2001.8.31)

(51) Int.Cl. ⁷	1/1000	微別記号	FΙ			テーマコード(参考)
G02F	1/1339	505	C 0 2 F	1/1339	505	2H089
0000	1/1368		C 0 9 F	9/00	338	2H092
G09F	9/00	338	G 0 2 F	1/136	500	5G435

審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 5 頁)

			12. 0 347
(21)出廢番号	特顧2000-45591(P2000-45591)	(71)出願人	00000;223
(22) 別属日	平成12年2月23日(2000.2.23)		富士通株式会社 神奈川県川崎市中原区 E小田中4丁目1番 1号
		(72)発明者	採田 克毅 鳥取県米子市石州府字大家ノ弐650番地 株式会社米子富士通内
		(74)代理人	100108187 弁理士 横山 淳一
		1	

最終頁に続く

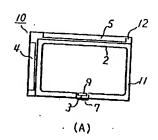
(54) 【発明の名称】 被晶表示パネルおよびその製造方法

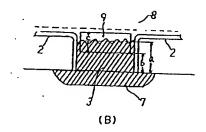
(57)【要約】

【課題】 液晶表示パネルに液晶注入後、注入用の開口 部を封止する際に、封止材が液晶表示領域にまで侵入して表示不良が発生するという課題を解消し、液晶表示装置の表示品質の向上を図る。

【解決手段】液晶表示パネル10の対向する2枚の基板の少なくとも一方の基板上の液晶注入用の開口部3と液晶表示領域8との間に、金属膜9を設けるよう構成する。

本発明の実施超級の液晶設示パネルの平面図





【特許請求の範囲】

【請求項1】 2枚の基板の少なくとも一方の基板に液晶注入用の開口部を残して液晶表示領域を囲むようにシール材を枠状に塗布し、対向して配置された該2枚の基板間を該シール材で固着した液晶表示パネルにおいて、該2枚の基板の少なくとも一方の基板上の前記開口部と前記液晶表示領域との間に、金属膜を設けたことを特徴とする液晶表示パネル。

【請求項2】 前記金属膜の材質は、アルミニウム、チタン、クロム、シリコンの何れかであることを特徴とする請求項1に記載の液晶表示パネル。

【請求項3】 2枚の基板の一方に少なくとも薄膜トランジスタ、ゲートバスラインおよびドレインバスラインが形成され、該2枚の基板の少なくとも一方の基板に液晶注入用の開口部を残して液晶表示領域を囲むようにシール材を枠状に塗布し、対向して配置された該2枚の基板間を該シール材で固着する液晶表示パネルの製造方法において、

該基板上の前記開口部と前記液晶表示領域との間に、金 属膜を前記ゲートバスラインと同一工程で形成すること を特徴とする液晶表示パネルの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、液晶表示パネルおよびその製造方法に関し、特に液晶表示パネル内にディップ注入法で液晶を注入する液晶表示パネルに関する。 【0002】

【従来の技術】近年、液晶表示装置は、薄型軽量、低電圧駆動、低消費電力等の長所を生かしパーソナルコンピュータ、テレビ、デジタルカメラ等の表示デバイスとして広く使用されるようになった。液晶表示装置を構成する液晶表示パネルは、一般にガラス等の2枚の透明基板間に液晶を封入した構造であり、一方の基板(CF基板)にはブラックマトリックス、カラーフィルタ、共通電極および配向膜等が形成され、他方の基板(TFT基板)には薄膜トランジスタ(以下、TFTという)、ゲートバスライン、ドレインバスライン、画素電極および配向膜等が形成されている。

【0003】2枚の透明基板間に液晶を注入する方法の一つとしてディップ注入法がある。

【0004】これは、2枚の透明基板の何れか一方の基板に液晶の注入用の開口部を残して表示領域を囲むようにシール材を塗布し、球や円柱状のスペーサを散布してこのシール材で2枚の基板間を固着する。その後真空中でこの液晶注入用の開口部を液晶中に漬けた状態で大気圧に戻すと、圧力差により液晶が基板間に注入される。

次に、開口部に熱硬化性または紫外線硬化性樹脂 (封止材)を塗布し、開口部を封止することにより液晶表示パネルが完成する。

【0005】図4は、このような従来の液晶表示パネル

組立工程の例を説明するものである。図4(A)に示すように、液晶注入用の開口部3を残してシール材2を塗布した基板1をスクライブラインXおよびYに沿って切断した一方の基板11と、端部にゲートバスラインと接続されたゲート端子4およびドレインバスラインと接続されたドレイン端子5が形成された他方の基板12とを固着し、開口部3から液晶を注入した後、開口部3を封止材7で封止して図4(B)に示す液晶表示パネル10となる。

[00061

【発明が解決しようとする課題】液晶注入用の開口部3から液晶を注入した後、この開口部3に封止材7を塗布するが、開口部3を完全に塞ぐためには、封止材7が表示領域に達しない程度に少しだけ開口部3の内部に侵入させておく必要がある。そのため封止材7である樹脂を塗布してから数秒から数十秒そのまま放置して樹脂が侵入してから熱または紫外線を照射して封止材7を硬化していた。

【0007】しかしながら、封止材7の粘度、開口部3の幅のばらつき、温度、湿度等の環境条件、基板がガラスの場合ガラス面の処理状態等により内部への封止材7の浸入速度が大きく変動し、開口部3の部分拡大平面図である図3に示すように封止材7が表示領域8にまで侵入してしまい表示不良が発生する問題がある。また近年の液晶表示パネルの狭額緑化(表示領域以外の部分が狭くなること)や、これら封止材7の混入に対する影響を受け易い低電圧駆動用液晶材料の採用により、封止材7の混入による表示不良も問題として浮上している。

【0008】なお、封止材が液晶表示パネル内部に侵入するのを規制するため、流路規制バーを開口部近傍に設けることが特開平2-055333号公報で提案されているが、これは実質的に液晶注入用の開口部の幅を狭めることになり液晶注入時間を大幅に増大させてしまう問題がある。

[0009]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため 請求項1の発明では、2枚の基板の少なくとも一方の基 板に液晶注入用の開口部を残して液晶表示領域を囲むようにシール材を枠状に塗布し、対向して配置された2枚 の基板間をシール材で固着した液晶表示パネルにおい て、この2枚の基板の少なくとも一方の基板上の開口部 と液晶表示領域との間に、金属膜を設けたことを特徴と する。また請求項2の発明は、この金属膜の材質は、ア ルミニウム、チタン、クロム、シリコンの何れかである ことを特徴とする。請求項3の発明は、2枚の基板の一 方に少なくとも薄膜トランジスタ、ゲートバスラインお よびドレインバスラインが形成され、この2枚の基板の 少なくとも一方の基板に液晶注入用の開口部を残して液 晶表示領域を囲むようにシール材を枠状に塗布し、対向 して配置された2枚の基板間をシール材で固着する液晶 表示パネルの製造方法において、この基板上の開口部と 液晶表示領域との間に、金属膜をゲートバスラインと同 一工程で形成することを特徴とする。

【0010】すなわち、本発明は液晶注入用の開口部と液晶表示領域の間の基板上に、金属膜を設けることにより、液晶表示パネルに液晶注入後に開口部を封止する際、封止材との間のぬれ性が変化することにより封止材が液晶表示領域まで侵入してしまうことがなくなり表示不良が発生しない。また金属膜は極めて薄いため液晶注入の際に妨げとならない。さらに金属膜の材質として、液晶表示パネルを構成する電極、配線の材質と同じものを使用することにより、従来の液晶表示パネルの電極、配線と同一工程で形成することができるので製造工数が増えることもない。

[0011]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態について説明する。図1(A)および図1(A)における開口部3の部分拡大図である図1(B)に示す如く、本発明では液晶表示パネル10の開口部3と液晶表示領域8との間であって基板12の面に金属膜9が形成されている。金属膜9の材質としては、実際には液晶表示パネルの製造工数を増やさないため、基板上に電極や配線を形成する工程で使用する材質を使用することが望ましい。例えば、TFTを使用する液晶表示パネルではアルミニウム(AI)、チタン(Ti)、クローム(Cr)、シリコン(Si)等が挙げられる。封止材7の液晶表示パネル10内への侵入速度は、封止材7の粘度および開口部3の大きさが一定ならば、ガラスと比較して金属膜の方が侵入速度は遅くなる。

【0012】従来の液晶表示パネルの開口部3近傍の基板表面はガラスが剥き出しになっており、ガラスの場合は封止材7が素早く侵入してしまい、封止材7の粘度、開口部3の大きさに対するマージンが狭かった。従来では封止材7の侵入速度はガラスに対して200μm/分程度であり、開口部3からの距離 aが700μm程度の侵入位置を設計中心値としているが、封止材7の粘度や開口部3の幅のばらつきにより3割程度侵入速度がばらつくと、210μm程度侵入距離が変動し、最大侵入距離は910μmとなってしまう。

【0013】これに対し、本発明における金属膜9の場合、封止材7の侵入速度は50μm/分程度と遅くなる。これはガラスおよび金属膜と封止材との間のぬれ性に関係して侵入速度が変化していると考えられる。金属膜9を開口部3から内側に向かっての距離bが650μmから幅cが150μmの幅に形成した場合、封止材7の侵入速度が3割ばらついても最大侵入距離は750μm程度になり、図1(B)に示すように設計値700μmの近くに収まる。このため封止材7が液晶表示パネル10の液晶表示領域8まで侵入することがなくなり、表示不良が生じない。 ガラス剥き出しの部分は、封止材

7が素早く侵入するが、金属膜9の部分は侵入速度が遅くなるので基板上に形成する金属膜9の大きさ、位置つまり図1(B)における距離b,幅cを種々変えることにより封止材7の侵入距離を設計的に微妙に制御することが可能となる。なお、金属膜9を基板12の上に形成する形態について述べたが金属膜9は基板11の上または基板11、12の両方に形成してもよい。

【0014】次に本発明における金属膜の形成をTFT 基板のゲート電極、ゲートバスライン形成と同一製造工程(以下、ゲート工程という)で行う場合の例を図2の本発明の実施態様による液晶表示パネルの製造工程を示す図により説明する。

【0015】まず、ステップS1においてガラス基板上 の塵埃や、アルカリ分等を除くため基板の洗浄を行う。 次にステップ2として基板上にゲート膜となる金属をス パッタリングやプラズマCVDにより成膜するが、本発 明の実施態様ではアルミニウムをゲート電極、ゲートバ スラインと同じ約1000オングストロームの厚さに成 膜する。次にその上にステップ3で紫外線に反応するレ ジストをスピンコーテングにより塗布する。次にステッ プ4で露光マスク6を介して紫外線露光を行うが、 この 露光マスク6にはゲート電極、ゲートバスライン以外 に、本発明の特徴である金属膜を液晶注入用の開口部3 近傍に形成するためのパターンが設けられていてゲート 電極、ゲートバスラインのパターンと同時に露光され る。次にステップ5で紫外線が照射された部分のレジス トを現像液に浸たして取り去る。次にステップ6でレジ ストに覆われてない部分のアルミニウム膜をエッチング 液に浸たして取り去る。次にステップ7で残っているレ ジストをレジスト剥離剤で剥離した後洗浄する。次にス テップ8で所望のゲート電極、ゲートバスライン、金属 膜等が形成されているか否か検査する。

【0016】本発明の実施態様では金属膜9として、液晶注入用の開口部3のガラス基板エッジからの距離b=650μmに短手方向の幅150μm、長手方向の幅15mmの長方形のパターンを形成する。

【0017】以上でTFT基板のゲート工程が終了するが、TFT基板の製造には、この後公知のTFT基板の製造方法により、ゲート絶縁膜、TFT、ドレイン電極、ドレインバスライン、画素電極、配向膜等が形成される。一方TFT基板と対向するCF基板にはブラックマトリックス、カラーフィルタ、共通電極、配向膜等が形成される。そしてCF基板にエポキシ樹脂等のシール材を塗布し、スペーサを散布した後、2枚の基板を貼り合わせる。なおシール材2を塗布する際に液晶注入用の開口部3を20mmだけ開けておき、液晶を注入する。液晶を注入した後スリーボンド製の紫外線硬化封止材(30Y-228)を使用し、封止材7を塗布してから250秒経った時に紫外線を照射して封止材7を硬化する。この結果、封止材7の流れは設計値700μmの近

くに収まり、このため封止材7が液晶表示パネル10の 液晶表示領域8まで侵入することがなくなり、表示不良 は生じない。

[0018]

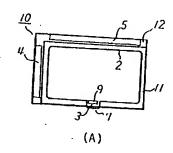
【発明の効果】以上説明したように、本発明は液晶表示 バネルへ液晶注入したあとの開口部を封止する際に、封 止材が液晶表示領域まで侵入することが阻止され、表示 不良が発生する問題が解消する。またこのための製造工 数の増加もなく、液晶表示装置の表示品質の向上に寄与 するところが大きい。

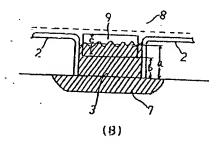
【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の実施態様の液晶表示パネルの平面図である。

【図1】

本発明の実施越様の液晶表示パネルの平面図





【図2】 本発明の実施態様による液晶表示パネルの製造工程を示す図である。

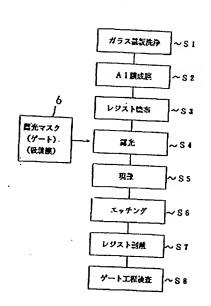
【図3】 従来の液晶表示パネルの課題を説明する図である。

【図4】 従来の液晶表示パネルの平面図である。 【符号の説明】

- 2 シール材
- 3 液晶注入用の開口部
- 7 封止材
- 8 液晶表示領域
- 9 金属膜
- 10 液晶表示パネル

【図2】

本発明の実施製権による紋晶表示パネルの製造工程を示す図

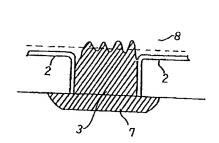


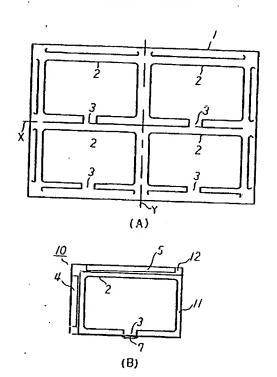
【図3】

従来の液晶表示パネルの課題を説明する図

【図4】

従来の被品表示パネルの平面図





フロントページの続き

Fターム(参考) 2H089 JA11 LA22 LA32 LA48 NA19
NA24 NA55 NA60 PA13 QA12
QA13 TA06 TA09
2H092 JA26 JA39 JB27 KA16 KA18
MA05 MA14 MA15 MA16 MA17
MA35 MA37 NA25 NA29 PA04
5G435 AA14 AA17 EE06 EE09 EE12

KKO2 KKO5 LLO4 LLO8 LL14